

編者的話

美國長期以來為專利權爭議處理最活躍的地區之一，隨著近年非專利實施實體（Non-Practicing Entities, NPEs）在美國提起專利爭訟愈多，影響我國半導體、電子與資通訊等出口導向產業於美國市場之布局，因而了解美國專利訴訟風險，面對跨國專利爭議時可妥善因應，進而鞏固技術領先地位，並拓展國際商機，至為重要。本期特別以「淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟」為專題，提出上、下 2 篇文章，介紹美國專利訴訟制度，並彙整研析近十年我國企業在美國所涉專利侵權訴訟的趨勢與特徵，以及面對 NPEs 威脅時的應對策略。本期另有「先申請主義與使用主義下不正當申請商標之比較法探討——以惡意申請及詐欺註冊為中心」及「AI 是否能成為規避工具？淺談美國法在授權遭拒後之實質相似性與故意侵權分析——以 Blade Runner 2049 v. Tesla 爭議為中心」之論述。以下就本期專題及論述簡介如下：

專題一由王安邦、黃本立、林士淵、李維恩所著「淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟（上）：案件趨勢與樣態分析」，本文以近十年我國企業涉入美國專利侵權訴訟之資料為研究基礎，針對案件數量趨勢、地理分布、技術領域及被訴企業特徵等面向進行系統性整理分析，藉以掌握我國企業在美國專利爭訟中的整體樣貌，並作為未來政策規劃及產業發展策略之參考。

專題二由王安邦、黃本立、林士淵、李維恩所著「淺談我國企業近十年涉入美國之專利侵權訴訟（下）：ITC 337 調查之專利爭訟實務觀察」，作者從美國國際貿易委員會依美國關稅法第 337 條所進行之實際調查案切入，說明案件發展歷程及各方當事人所採取之訴訟策略，並進一步提出我國企業在美國專利風險管理及爭訟因應方面之建議。

論述一由陳昭華、王敏銓所著「先申請主義與使用主義下不正當申請商標之比較法探討——以惡意申請及詐欺註冊為中心」，作者從比較法之視角出發，以德國及我國法制中之「惡意申請」，以及美國法制中之「詐欺註冊」為分析核心，探討在不同商標權取得模式下，不正當申請規範之制度定位與法理基礎，藉此了解各國如何回應不正當商標申請之問題。

論述二由吳宗穎所著「AI 是否能成為規避工具？淺談美國法在授權遭拒後之實質相似性與故意侵權分析——以 Blade Runner 2049 v. Tesla 爭議為中心」，本文以美國近期備受關注之「Blade Runner 2049 v. Tesla」爭議為例，並參酌美國聯邦第九巡迴上訴法院相關判決見解，分析生成式人工智慧作為創作工具時，是否影響美國既有著作權侵權分析架構的適用與運作。